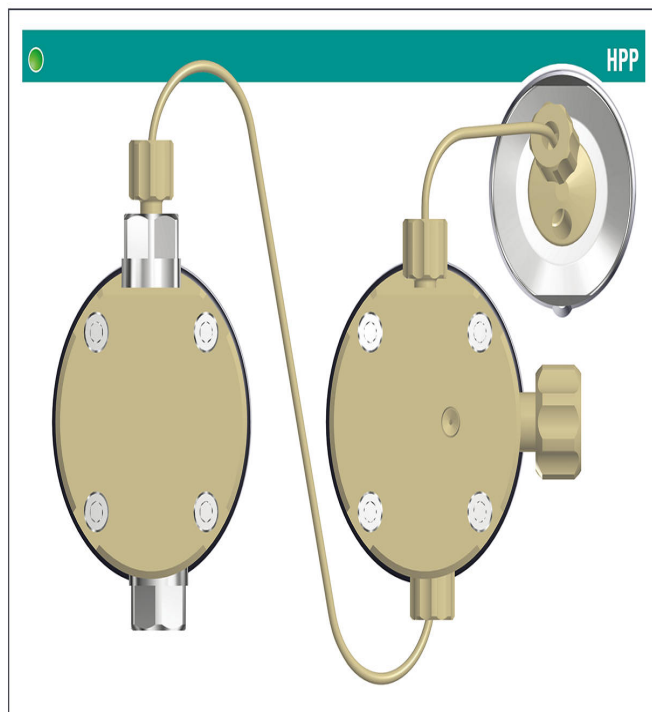




OMNIS High-Pressure Pump Unit

2.1056.0210

L'unité de pompe haute pression OMNIS IC est une pompe haute pression avancée et résistante aux produits chimiques, spécialement conçue pour la chromatographie ionique.

Elle est dotée d'une distribution d'éluants contrôlée par pulsation, où le volume de distribution est automatiquement compensé, éliminant ainsi le besoin d'amortisseurs de pulsations supplémentaires. La course est optimisée de manière dynamique selon les conditions de fonctionnement pour garantir une performance optimale. 2 moteurs individuels synchronisés garantissent un contrôle précis et des débits d'écoulement cohérents. Le piston est relié au moteur plutôt qu'à la tête de la pompe, ce qui améliore la stabilité et simplifie l'entretien. Le trajet d'écoulement est exempt de métal et chimiquement inerte, garantissant une compatibilité maximale avec les fluides agressifs. En outre, la pompe résiste à des substances dont le pH varie entre 0 et 14, ce qui la rend adaptée à un large éventail d'applications.

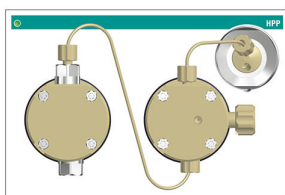
L'unité de pompe haute pression OMNIS IC peut être équipée en option d'un joint de piston pour empêcher la cristallisation et minimiser l'entretien. L'OMNIS High-Pressure Pump Unit comprend une vanne de purge manuelle. Si un injecteur 7/3 est installé dans l'OMNIS IC System, le processus de purge peut être entièrement automatisé.

Spécifications :

- Plage de pression : 0 à 42 MPa
- Gamme d'écoulement : 0,0001 à 10,000 mL/min
- Précision de l'écoulement : 0,1 %
- Reproductibilité de l'écoulement : 0,1 %
- Pulsation : 0,1 %
- Matériau de la tête de la pompe : PEEK

Contenu de la livraison 2.1056.0210

Order Number	Description	Quantité
1.1056.0210	OMNIS High-Pressure Pump Unit L'OMNIS IC High-Pressure Pump Unit est une pompe haute pression avancée et résistance aux produits chimiques, conçue spécialement pour la chromatographie ionique. Elle assure une distribution des éluants contrôlée par pulsations, le volume de distribution étant automatiquement compensé, ce qui élimine les besoins en amortisseurs de pulsation supplémentaires. La course est optimisée de manière dynamique en fonction des conditions de fonctionnement, garantissant ainsi des performances optimales. Deux entraînements individuels synchronisés permettent un contrôle précis et des débits constants. Le piston est connecté à l'entraînement, plutôt qu'à la tête de pompe, ce qui renforce la stabilité et simplifie la maintenance. Le trajet d'écoulement est exempt de métal et inerte chimiquement afin de garantir une compatibilité maximale avec les fluides agressifs. De plus, la pompe résiste aux substances sur une large gamme de pH de 0 à 14. Elle convient donc à un large spectre d'applications. L'OMNIS IC High-Pressure Pump Unit peut être équipée en option du nettoyage du joint du piston afin de prévenir la cristallisation et de réduire la maintenance. L'OMNIS High-Pressure Pump Unit intègre une vanne de purge manuelle. Le processus de ventilation peut être entièrement automatisé en installant un injecteur 7/3 dans l'OMNIS IC System.	1 PCS



6.01831.110

Capillaire PEEK HPP - INJ, 160/0,5 mm

1 PCS

Capillaire PEEK prédécoupé avec étiquette d'identification
pour OMNIS IC



Accessoires optionnels

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



6.2821.120

Filtre inline 2 µm

Filtre inline 2 µm



6.02621.010

Outil multifonction, HPP

Outil multifonction pour la maintenance de l'OMNIS High-Pressure Pump Unit.



6.02741.000

Joint de piston, PE, orange

Joint de piston pour l'OMNIS IC High-Pressure Pump Unit.



6.02741.030

Kit de maintenance, joint de nettoyage du piston, 2 pcs.

Kit de maintenance pour le nettoyage du joint du piston de l'OMNIS IC High-Pressure Pump Unit.



6.02824.000

Piston de pompe, ZrO₂, 3,8 mm

Piston de pompe pour l'OMNIS IC High Pressure Pump.



6.02824.010

Clapet entrée, PEEK

Clapet anti-retour exempt de métal pour le côté de sortie de l'OMNIS IC High Pressure Pump Unit.



6.02824.020

Clapet sortie, PEEK

Clapet anti-retour exempt de métal pour le côté de sortie de l'OMNIS High-Pressure Pump Unit.



6.05332.020

**Équipement OMNIS IC :
nettoyage du joint du piston
HPP, DD**

Jeu d'accessoires pour le nettoyage du joint du piston HPP : le nettoyage du joint du piston HPP pour l'OMNIS IC HPP est prévu en standard via un port libre sur le système de dosage sur l'OMNIS Cylinder Unit. Après chaque analyse d'échantillon, le piston est rincé avec une petite proportion d'eau UPW.

En alternative, si aucun canal Cylinder Unit libre n'est disponible, l'eau UPW peut être transférée via un canal de pompe péristaltique, équipé d'un tuyau de pompe péristaltique 601826010.

Conditions préalables :

OMNIS IC S/M/L, comprenant :

- Port OMNIS Cylinder Unit disponible (avec eau UPW comme solvant de travail) ou
- Canal d'OMNIS Peristaltic Pump Unit disponible



6.05801.010

**Kit de nettoyage du joint du
piston**

Kit de mise à niveau permettant d'ajouter le nettoyage du piston à l'OMNIS High-Pressure Pump Unit. Les joints de nettoyage du piston sont inclus.

Conditions préalables :

- 2.1056.0210 OMNIS High-Pressure Pump Unit
- 6.02621.010 Outil multifonction, HPP

